

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2023年7月6日(06.07.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/127942 A1

- (51) 国際特許分類:  
H01L 21/304 (2006.01) C09K 3/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/048486
- (22) 国際出願日: 2022年12月28日(28.12.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2021-213908 2021年12月28日(28.12.2021) JP
- (71) 出願人: セントラル硝子株式会社  
(CENTRAL GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/  
JP]; 〒7550001 山口県宇部市大字沖宇部 5  
2 5 3 番地 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者: 奥村 雄三 (OKUMURA Yuzo);  
〒1010054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 7 番  
地 1 セントラル硝子株式会社内 Tokyo (JP).  
鉄村 美月(TETSUMURA Mizuki); 〒1010054 東

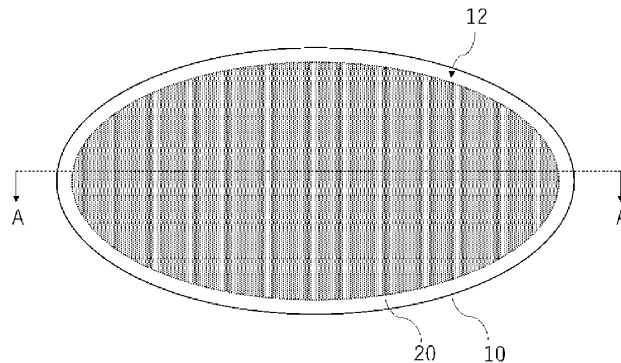
京都千代田区神田錦町 3 丁目 7 番地 1 セン  
トラル硝子株式会社内 Tokyo (JP). 吉田 彩  
香(YOSHIDA Ayaka); 〒1010054 東京都千代田  
区神田錦町 3 丁目 7 番地 1 セントラル硝子  
株式会社内 Tokyo (JP). 塩田 彩織(SHIOTA  
Saori); 〒1010054 東京都千代田区神田錦町 3 丁  
目 7 番地 1 セントラル硝子株式会社内 Tokyo  
(JP). 照井 貴陽(TERUI Yoshiharu); 〒1010054  
東京都千代田区神田錦町 3 丁目 7 番地 1 セ  
ントラル硝子株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031  
東京都品川区西五反田 7 丁目 9 番 2 号 K  
D X 五反田ビル 9 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保  
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: COMPOSITION FOR FILM FORMATION AND METHOD FOR PRODUCING SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 膜形成用組成物、および基板の製造方法



(57) Abstract: A composition for film formation according to the present disclosure is used for the purpose of forming a water repellent film on at least a part of the surface of a substrate by being supplied to the substrate, the surface of which is covered with a protic liquid. This composition for film formation contains a silylating agent which silylates the surface of the substrate, a catalytic compound which promotes the silylation reaction by the silylating agent, and an aprotic solvent; and the content of the catalytic compound is 1.0% by mass or more in 100% by mass of this composition for film formation.

(57) 要約: 本開示の膜形成用組成物は、表面がプロトン性液体に覆われた状態の基板に供給して、その表面の少なくとも一部に撥水性膜を形成するために用いる膜形成用組成物であって、基板の表面をシリル化する、シリル化剤と、シリル化剤によるシリル化反応を促進する触媒性化合物と、非プロトン性溶媒と、を含み、触媒性化合物の含有量が、当該膜形成用組成物 100 質量%中、1.0 質量%以上である。

[続葉有]

WO 2023/127942 A1

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,  
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,  
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,  
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,  
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))